**EUROPEAN PATENT OFFICE** 

## **Patent Abstracts of Japan**

108676

PUBLICATION NUMBER **PUBLICATION DATE** 

02281782 19-11-90

APPLICATION DATE

24-04-89

APPLICATION NUMBER

01105205

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD:

INVENTOR: NAGAI HIDEO:

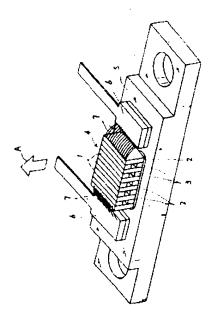
INT.CL.

: H01S 3/18 H01S 3/25

TITLE

: SEMICONDUCTOR LASER ARRAY

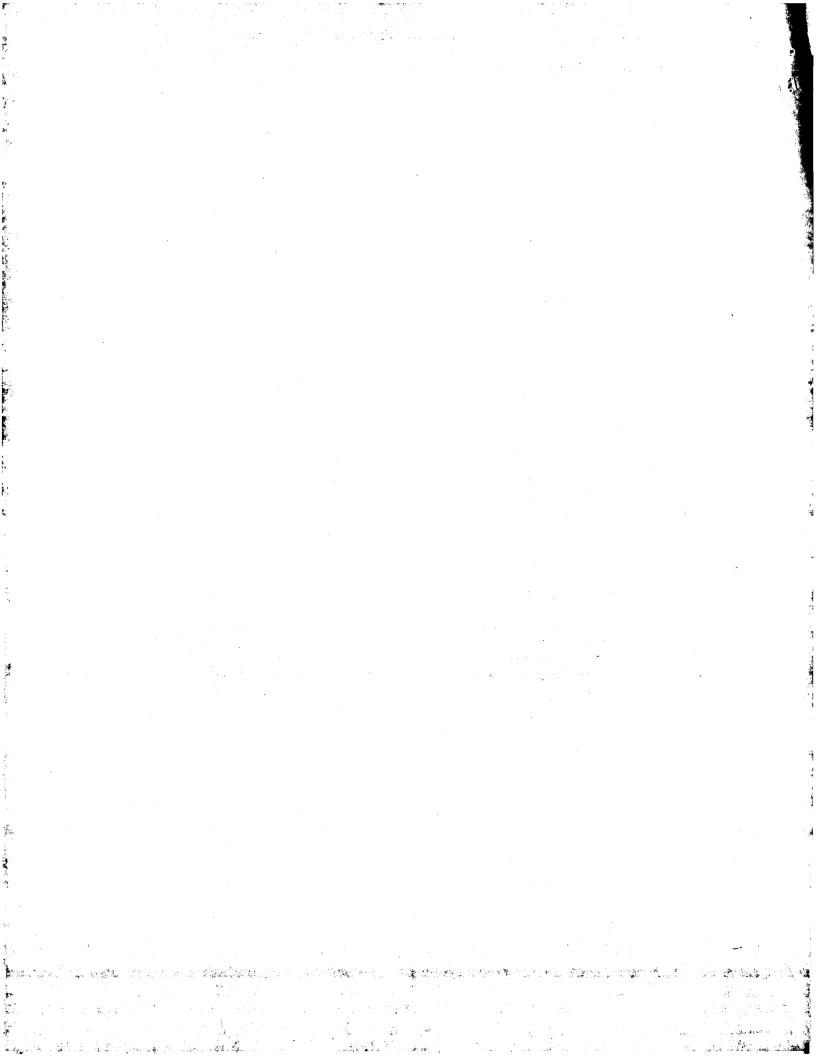
**DEVICE** 



ABSTRACT: PURPOSE: To obtain continuous oscillation by placing a two-dimensional semiconductor array, wherein plural pieces of one-dimensional semiconductor arrays are placed in layer shape between insulating plates excellent in heat conductivity, on a heat radiating member through the insulating plates.

> CONSTITUTION: Plural pieces of one-dimensional semiconductor arrays 1 are placed in layer shape between insulating plates 2 excellent in heat conductivity so as to constitute a two-dimensional semiconductor laser array 4, and this two-dimensional semiconductor laser array 4 is placed on a heat radiating member 5 through the insulating plates 2. For the material of the insulating plates 2, BN is used which is almost the same as GaAs being laser crystals in point of cost and in heat expansion coefficient. Hereby, the heat generated from the one-dimensional semiconductor laser array 1 is transmitted to the heat radiating member 5 through the insulating plate 2 excellent in heat conductivity, and heat radiation is performed enough, and the temperature rise of the semiconductor laser array device is suppressed, and also continuous oscillation becomes possible.

COPYRIGHT: (C) JPO



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-281782

30Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)11月19日

H 01 S 3/18

7377-5F

7630-5F H 01 S 3/23

S

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 半導体レーザアレイ装置

②特 願 平1-105205

②出 顕 平1(1989)4月24日

の発明者 粂 の発明者 内藤 雅博

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑦発 明 者 永 井 秀 男 ⑦出 顧 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 森本 義弘

1. 発明の名称

半導体レーザアシイ装置

2. 特許請求の範囲

1. 複数個のレーザ光出射点が一次元に並べられてなる一次元半導体レーザアレイを、無伝導性の良い絶縁板の間に複数個層状に配度して二次元半導体レーザアレイを構成し、かつこの二次元半導体レーザアレイを、その絶縁板を介して放無部材上に戦震した半導体レーザアレイ装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、固体レーザ結晶の励起や、加工用に用いられる高出力の半導体レーザアレイ装置に関するものである。

従来の技術

半導体レーザはスペクトル幅が狭く高効率であり、Nd:YAG結晶などの固体レーザ結晶の吸収スペクトルに被長を合わせることにより効率良

く励起できるため、従来のランプに代る固体レー ザ励起光源として近年往目を集めるようになって きた。半導体レーザを固体レーザの効起光泵とし て用いる場合、幼紀光源の光密度が高いことが必 要となる。半導体シーザの発光領域の大きさは10 μm×2μm程度であるため、多数の発光部であ るレーザ光出射点を一次元(直線的)あるいは二 次元(平面的)に並べた半導体レーザアレイとす ることにより、極めて高い光密度を得ることが可 能である。半導体レーザをYAGレーザの励起光 原に用いた場合の籍合効率は、半導体レーザの電 気 - 光変換効率が30%、YAGレーザの入力励起 光-レーザ出力光変換勿率が30%であるので、10 %近い値が得られ、これはランプ励起の場合の10 **甾以上となる。また、余分な波長の光の吸収によ** る結晶の発熱がなく、YAGレーザの冷切も軽減 される。従来、半導体レーザで高出力を得る場合、 多数のレーザ光出射点を高密度でもって二次元に すなわち平面上に配置する必要がある。ところで、 半導体レーザは結晶の劈関面を共短器に用いるた

### 持開平2-281782(2)

め、一枚の基板上にモノリシックにレーチ光出射 点を並べることは容易ではない。そこで一次元に レーザ光出射点を並べたパー状の半導体レーチア レイを用い、これをさらに二次元に配置すること が考えられる。

#### 発明が解決しようとする課題

 の遅いパルス動作しかさせることができない。

そこで、本発明は上記課題を解消し得る半導体 レーザアレイ装置を提供することを目的とする。 課題を解決するための手段

上記録類を軽決するため、本発明の半導体レーザアレイ装置は、複数個のレーザ光出射点が一次元に並べられてなる一次元半導体レーザアレイを、然伝導性の良い絶縁板の間に複数個層状に配置して二次元半導体レーザアレイを、その絶縁板を介して放無部材上に収置したものである。

#### 作用

上記の構成において、一次元半導体レーザアレイから発生した無は熱伝導性の良い絶縁仮を介して放無部材に伝導されて、放無が十分に行われる。 したがって半導体レーザアレイ装置の温度上昇が 抑制されるとともに連続発症も可能となる。

#### 実施例

以下、本発明の一実施例を図面に基づき説明する。

第1回に半導体レーザアレイ装置の外観斜視図、 第2回に同装置の要部斜視図および部品分解斜視 図を示す。

第1回および第2回において、1はたとえば10 個のレーザ光出射点(発光点とちいう)が100 μπの間隔で一次元に並べて構成されたパー状の 一次元半導体レーザアレイで、長さ 1.2 mm 、厚さ 100μm、共振器長さ 250μmとされている。こ の一次元半導体レーザアレイ1は、5個並置され るとともに、これらの間および両外側に熱伝導性 の良い材料で構成された粕燥板2が介装されて圏 状にされるとともに、一次元半導体レーザアレイ 1とは反対側の各絶縁板2の間に、絶縁板2と同 じ材質で構成された絶様スペーサ3が介装されて、 こ次元半導体レーザアレイ4が構成されている。 そして、さらにこの間状の二次元半導体レーザア レイ4は、その絶縁スペーサ3側の増面がヒート シンク(放無部材)5の表面に接触するように、 ヒートシンク5上に教置されている。なお、上記 絶縁仮2の材質としては、熱伝導率の点ではダイ

-------

ヤモンドが一番優れているが、コストの点と無影 猛係数がレーザ結晶であるGaASとほとんど同 じであるという点でBNの方が優れている。BN の熱伝導率はダイヤモンドの3分の1であるが銅 より2倍以上と優れているので本実施例において はBNが使用されている。また、絶縁板2の厚さ は 100μmとされており、第2団に示すように、 上下部の表面にはCr-Pt-Auのメタライズ パターンaがほどこされている。なお、金パター ン上にはAu-Sn、Pb-Snなどの半田材が 競者され、一次元半導体レーザアレイ1と**破**着で きるようにされている。上記半田材は熱伝導性が 悪いため、その農庫は3μmと薄くされている。 また、上記二次元半導体レーザアレイ4は、金メ ッキされた銅製のヒートシンク5上に、Pb-Snなどの半田材を用いて融着されており、もち ろん絶縁スペーサ3を介装したのは、ヒートシン ク5との熱伝導面積を増加させるためである。上 記絶様スペーサ3の表面にも金のメタライズパタ ーンaがほどこされている。なお、ヒートシンク

### 特閒平2-281782(3)

 $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ 

T

5 朗の電極端子らと二次元半導体レーザアレイ4の電極端子としての両側部の絶縁板2とは金ワイヤ7で接続され、また10A近い大電流を流すため、金ワイヤ7の本数は50木程度にされている。

上記欄成においては、各一次元半導体レーザアレイ1で発生した熱は、絶縁板2および絶様スペーサ3を介してヒートシンク5側に伝導されて、放焦が十分に行われる。なお、第1図および第2図中、矢印Aは二次元半導体レーザアレイ4から出射されるレーザ光である。

ここで、上記の半導体レーザアレイ装置における電流ー出力特性を第3回に示す。なお、一次元半導体レーザアレイ1が5本直列に接続されているので、印加電圧は約10Vとなる。第3回から分かるように、6Aの電流で20W以上の光出力が得られており、電気からレーザ光への変換効率は33%と非常に良い結果が得られている。発光部であるレーザ光出射度の面積は約1mlであるので光密度は2KW/cdとなり、YAGレーザの励起光源としては過足すべき特性が得られている。

置における電流一光出力特性図である。

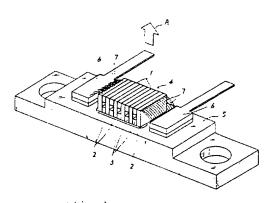
1 ··· - 次元半導体レーザアレイ、2 ··· 絶縁板、3 ··· 絶縁なペーサ、4 ··· 二次元半導体レーザアレイ、5 ··· ヒートシンク。

代理人 森 本 義 弘

なお、始縁板2 および絶縁スペーサ3 の材質として、 類(Cu)、ダイヤモンド(C) の他に、たとえば発化ホウ素(BN)、炭化ケイ素(SiC)、ベリリア(BeO)、変化アルミニウム(A2N)などが使用される。 発明の効果

第1回は本発明の半導体レーザアレイ装置の外 設料視回、第2回は同半導体レーザアレイ装置の 要部の斜視回、第3回は同半導体レーザアレイ装

第/图



ノ… 一次元半事体レーザアレイ

2 ... 艳椽板

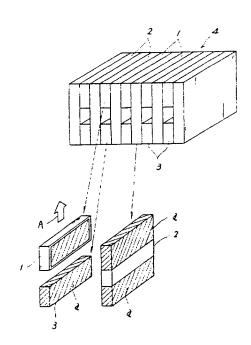
ョ…絶様スペーサ

4…二次元半事体レーサアレイ

5 . ヒートシンク

# 持開手2-281782 (4)

**第 2 図** 



第3図

